

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成23年6月2日(2011.6.2)

【公開番号】特開2009-26751(P2009-26751A)

【公開日】平成21年2月5日(2009.2.5)

【年通号数】公開・登録公報2009-005

【出願番号】特願2008-159058(P2008-159058)

【国際特許分類】

H 05 B 33/10 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

H 05 B 33/22 (2006.01)

【F I】

H 05 B 33/10  
H 05 B 33/14 A  
H 05 B 33/22 Z

【手続補正書】

【提出日】平成23年4月18日(2011.4.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に光触媒性導電膜を形成し、

前記光触媒性導電膜の端部を覆うように前記基板上に絶縁膜を形成し、

前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜を酸化処理し、

前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜上にシランカップリング剤膜を形成し、

前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜上に光を照射して、前記光触媒性導電膜上の前記シランカップリング剤膜を分解し、

前記光触媒性導電膜上に溶液を塗布し、

前記光触媒性導電膜表面における前記溶液に対する接触角を30°以下とすることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項2】

基板上に光触媒性導電膜を形成し、

前記光触媒性導電膜の端部を覆うように前記基板上に絶縁膜を形成し、

前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜を酸化処理し、

前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜上にシランカップリング剤膜を形成し、

前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜上に光を照射して、前記光触媒性導電膜上の前記シランカップリング剤膜を分解し、

前記光触媒性導電膜上に溶液を塗布し、

前記光触媒性導電膜表面における前記溶液に対する接触角を30°以下とし、かつ前記光触媒性導電膜表面における前記溶液に対する接触角と、前記絶縁膜表面における前記溶液に対する接触角との差を20°以上とすることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、

前記酸化処理は、酸素に紫外線を照射して得られる活性酸素およびオゾンに晒す処理、または酸化性気体雰囲気下でのプラズマアッティング処理であることを特徴とするパターン

形成方法。

【請求項 4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一において、  
前記シランカップリング剤膜は、化学式Rn-Si-X(4-n)（但し、n=1~3  
、Xは加水分解基、Rはフルオロアルキル基）のフルオロアルキルシランからなることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項 5】

請求項1乃至請求項4のいずれか一において、  
前記光は、前記光触媒性導電膜を形成する材料のバンドギャップ以上のエネルギーに相当する波長の光であることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項 6】

請求項1乃至請求項5のいずれか一において、  
前記光は、390nm以下の波長の光であることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項 7】

請求項1乃至請求項6のいずれか一において、  
前記光触媒性導電膜は、インジウム錫酸化物、酸化インジウムに2%以上20%以下の酸化亜鉛を混合したインジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を組成物として有するインジウム錫酸化物、錫をドーピングした酸化インジウム、酸化亜鉛、アルミニウムをドーピングした酸化亜鉛、ガリウムをドーピングした酸化亜鉛、酸化チタン、または酸化錫であることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項 8】

基板上に薄膜トランジスタを形成し、  
前記薄膜トランジスタと電気的に接続された光触媒性導電膜を形成し、  
前記光触媒性導電膜の端部を覆うように絶縁膜を形成し、  
前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜を酸化処理し、  
前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜上にシランカップリング剤膜を形成し、  
前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜上に光を照射して、前記光触媒性導電膜上の前記シランカップリング剤膜を分解し、  
前記光触媒性導電膜上有機化合物を含む溶液を塗布して、前記有機化合物を含む層を形成し、  
前記有機化合物を含む層上に導電膜を形成し、  
前記光触媒性導電膜表面における前記溶液に対する接触角を30°以下とすることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 9】

基板上に薄膜トランジスタを形成し、  
前記薄膜トランジスタと電気的に接続された光触媒性導電膜を形成し、  
前記光触媒性導電膜の端部を覆うように絶縁膜を形成し、  
前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜を酸化処理し、  
前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜上にシランカップリング剤膜を形成し、  
前記光触媒性導電膜および前記絶縁膜上に光を照射して、前記光触媒性導電膜上の前記シランカップリング剤膜を分解し、  
前記光触媒性導電膜上有機化合物を含む溶液を塗布して、前記有機化合物を含む層を形成し、  
前記有機化合物を含む層上に導電膜を形成し、  
前記光触媒性導電膜表面における前記溶液に対する接触角を30°以下とし、かつ前記光触媒性導電膜表面における前記溶液に対する接触角と、前記絶縁膜表面における前記溶液に対する接触角との差を20°以上とすることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 10】

請求項8または請求項9において、  
前記酸化処理は、酸素に紫外線を照射して得られる活性酸素およびオゾンに晒す処理、

または酸化性気体雰囲気下でのプラズマアッシング処理であることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 1 1】

請求項8乃至請求項1 0のいずれか一において、  
前記シランカップリング剤膜は、化学式R<sub>n</sub>-Si-X(4-n)(但し、n=1~3  
、Xは加水分解基、Rはフルオロアルキル基)のフルオロアルキルシランからなることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 1 2】

請求項8乃至請求項1 1のいずれか一において、  
前記光は、前記光触媒性導電膜を形成する材料のバンドギャップ以上のエネルギーに相当する波長の光であることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 1 3】

請求項8乃至請求項1 2のいずれか一において、  
前記光は、390nm以下の波長の光であることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 1 4】

請求項8乃至請求項1 3のいずれか一において、  
前記光触媒性導電膜は、インジウム錫酸化物、酸化インジウムに2%以上20%以下の酸化亜鉛を混合したインジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を組成物として有するインジウム錫酸化物、錫をドーピングした酸化インジウム、酸化亜鉛、アルミニウムをドーピングした酸化亜鉛、ガリウムをドーピングした酸化亜鉛、酸化チタン、または酸化錫であることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 1 5】

請求項8乃至請求項1 4のいずれか一において、  
前記有機化合物は、発光性材料、正孔注入性材料、正孔輸送性材料、電子輸送性材料または電子注入性材料であることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 1 6】

基板上に形成された薄膜トランジスタと、  
前記薄膜トランジスタと電気的に接続された光触媒性導電膜と、  
前記光触媒性導電膜の端部を覆うように形成された絶縁膜と、  
前記絶縁膜上に形成されたシランカップリング剤膜と、  
前記光触媒性導電膜上に溶液を塗布して形成された有機化合物を含む層と、  
前記シランカップリング剤膜および前記有機化合物を含む層上に形成された導電膜と、  
を有することを特徴とする発光装置。

【請求項 1 7】

請求項1 6において、  
前記光触媒性導電膜表面における前記溶液に対する接触角が30°以下であることを特徴とする発光装置。

【請求項 1 8】

請求項1 6において、  
前記光触媒性導電膜表面における前記溶液に対する接触角が30°以下であり、かつ前記光触媒性導電膜表面における前記溶液に対する接触角と、前記シランカップリング剤膜表面における前記溶液に対する接触角との差が20°以上であることを特徴とする発光装置。

【請求項 1 9】

請求項1 6乃至請求項1 8のいずれか一において、  
前記光触媒性導電膜は、インジウム錫酸化物、酸化インジウムに2%以上20%以下の酸化亜鉛を混合したインジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を組成物として有するインジウム錫酸化物、錫をドーピングした酸化インジウム、酸化亜鉛、アルミニウムをドーピングした酸化亜鉛、ガリウムをドーピングした酸化亜鉛、酸化チタン、または酸化錫からなることを特徴とする発光装置。

**【請求項 20】**

請求項16乃至請求項19のいずれか一において、  
前記シランカップリング剤膜は、化学式R<sub>n</sub>-Si-X(4-n)（但し、n=1~3  
、Xは加水分解基、Rはフルオロアルキル基）のフルオロアルキルシランからなることを  
特徴とする発光装置。